

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 2 区分
 【発行日】平成22年11月18日 (2010.11.18)

【公表番号】特表2002-536687(P2002-536687A)
 【公表日】平成14年10月29日 (2002.10.29)
 【出願番号】特願2000-597656(P2000-597656)
 【国際特許分類】

G 0 2 F 1/1337 (2006.01)

G 0 2 F 1/13 (2006.01)

G 0 2 F 1/139 (2006.01)

【 F I 】

G 0 2 F 1/1337

G 0 2 F 1/13 5 0 0

G 0 2 F 1/139

【誤訳訂正書】

【提出日】平成22年10月1日 (2010.10.1)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】特許請求の範囲

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 液晶ポリマーのエレメントを製造する方法であって、材料に、ある特性を与える工程を含み、前記特性が、該材料の層上に配置され又は該材料と混合される架橋性モノマー又はプレポリマー液晶分子が、選択配列を採択することであり、前記方法が、前記材料を、斜め方向から、偏光されず又は円形に偏光された放射線にさらす工程を含み、前記材料は該放射線によって架橋し、この露光された材料に塗布され、又は混合されるモノマー又はプレポリマー液晶分子に、前記選択配列を採択させ、かつ配列される際にそれらを架橋する工程を含み、

前記選択配列を達成するのに、前記材料の斜め方向からの放射線への単一の暴露工程が十分なものであり、かつ、

前記選択配列が、前記液晶分子の長軸が、前記層の法線と前記放射線の方向とを含む平面内にあるような配列である方法。

【請求項 2】 前記材料がさらされる前記放射線が、帯状様式にパターン化され、それによって、前記与えられる特性において、前記選択配列が、帯状様式にパターン化される、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】 液晶ポリマーのエレメントを製造する方法であって、材料に、ある特性を与える工程を含み、前記特性が、該材料の層上に配置され又は該材料と混合される架橋性モノマー又はプレポリマー液晶分子が、選択配列を採択することであり、前記方法が、前記材料を、斜め方向から、偏光されず又は円形に偏光された放射線にさらす工程を含み、前記材料がさらされる前記放射線が、帯状様式にパターン化され、単一の放射線工程において局所的に異なる斜めの放射線を生成し、前記与えられる特性において、前記選択配列が、帯状様式にパターン化され、この露光された材料に塗布され、又は混合されるモノマー又はプレポリマー液晶分子に、前記選択配列を採択させ、かつ配列される際にそれらを架橋する工程を含み、前記選択配列が、前記液晶分子の長軸が、前記層の法線と各帯に対応する前記放射線の方向とを含む平面内にあるような配列である方法。

【請求項 4】 前記材料が、前記放射線で架橋される、請求項 3 に記載の方法。

【請求項 5】 前記放射線に直交に測定された前記照射エネルギーが、 2 J/cm^2 未満

である請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 6】 前記放射線が、紫外線である請求項 1 ~ 5 のいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 7】 前記材料が、実質的にホメオトロピックに配向する、請求項 1 ~ 6 のいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 8】 前記放射線の前記層の法線に対する入射角 が、 $5^{\circ} < 70^{\circ}$ の範囲内である、請求項 1 ~ 7 のいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 9】 前記入射角が、 $> 45^{\circ}$ である、請求項 1 ~ 8 のいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 10】 前記選択配列が平面である、請求項 1 ~ 9 のいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 11】 前記特性が、さらに、このような液晶分子が架橋されて、そのチルト及び配列が固定する前に、該液晶分子に、選択チルト及び選択方位配列を与える工程を含む、請求項 1 ~ 9 のいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 12】 与えられる選択チルトが、前記層の面に対して 45° を超える、請求項 11 に記載の方法。

【請求項 13】 前記放射線源と前記材料との間に、マイクロエレメント配列を介入させることによって、単一の放射工程において放射線を帯状様式にパターン化して局所的に異なる斜めの放射線の生成を達成する、請求項 3 ~ 12 のいずれか 1 項に記載の方法。